WO 2005/044776 PCT/JP2004/016703

明 細 瞽

3, 3-ジメチル-2- (1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸エステルの製造方法

技術分野

5 本発明は3,3-ジメチル-2-(1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸エステルの製造方法に関する。

背景技術

3, 3-ジメチルー2-(1-プロペニル) -シクロプロパンカルボン酸およびそ のエステルは、家庭用防疫薬の酸部分として重要な化合物であり(例えば、特公昭54-3933号公報参照。)、その製造方法としては、脱炭酸反応による方法が知られており、例えば3, 3-ジメチルー2-(2-カルボキシー1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸を無溶媒条件で加熱することにより、3, 3-ジメチルー2-(1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸が得られる(例えば、J.Chem.Soc.,(C),2739(1971)参照。)。しかし、当該反応は、選択性が低いことから工業的な製法として十分なものではなかった。

発明の開示

本願発明の方法によれば、3,3-ジメチル-2-(2-カルボキシ-1-プロペ20 ニル)シクロプロパンカルボン酸エステルの脱炭酸反応が選択性良く進行し、所望の3,3-ジメチル-2-(1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸エステルを工業的に有利に製造することができる。

すなわち本発明は、式(1):

25 (式中、R₁は置換されていてもよいアルキル基、置換されていてもよいアリール基 または置換されていてもよいアラルキル基を表わす。) で示される3,3-ジメチル-2-(2-カルボキシ-1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸エステルを銅化合物および含窒素芳香族化合物と接触させることを特徴とする式(2):

$$\bigcirc 0 \\ 0 \\ 0 \\ R_1$$
 (2)

5 (式中、R₁は上記のとおり。)

で表される3,3-ジメチル-2-(1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸エステルの製造方法を提供するものである。

発明を実施するための最良の形態

10 以下、本発明を詳細に説明する。

15

25

式(1)で示される3,3ージメチルー2ー(2ーカルボキシー1ープロペニル)ーシクロプロパンカルボン酸エステル(以下、第2菊酸エステル(1)と記載する。)の製法としては特に限定されないが、例えば、特開2000ー256253号公報に記載されているように、3,3ージメチルー2ーホルミルーシクロプロパンカルボン酸エステルと、例えばメチルマロン酸等のジカルボン酸誘導体とを、第2級アミンの存在下に反応させることにより、高収率で得ることができる。

第2菊酸エステル(1)の置換基R₁について以下説明する。

R₁で表されるアルキル基としては、例えばメチル基、エチル基、 nープロピル基 、イソプロピル基、 nーブチル基、イソブチル基、 s e c ーブチル基、 t e r t ーブ 20 チル基、 nーペンチル基、 nーデシル基、 ウンデシル基、 ドデシル基、 トリデシル基 、テトラデシル基、ペンタデシル基、 へキサデシル基、 ヘプタデシル基、 オクタデシル基、 ノナデシル基、 ドデシル基、 シクロプロピル基、 2 , 2 ージメチルシクロプロピル基、 シクロペンチル基、 シクロペキシル基、 メンチル基等の直鎖状、 分枝鎖状または環状の炭素数 1~200アルキル基が例示される。

前記アルキル基の置換基としては、例えばメトキシ基、エトキシ基、nープロポキシ基、イソプロポキシ基、nーブトキシ基、イソブトキシ基、secーブトキシ基

WO 2005/044776

5

10

20

、tertープトキシ基、トリフルオロメトキシ基等の炭素数1~20の置換されていてもよいアルコキシ基、

例えばフェノキシ基、2-メチルフェノキシ基、4-クロロフェノキシ基、4-メチルフェノキシ基、4-メトキシフェノキシ基、3-フェノキシフェノキシ基等の 炭素数6~20の置換されていてもよいアリールオキシ基、

例えばベンジルオキシ基、4-クロロベンジルオキシ基、4-メチルベンジルオキシ基、2, 3 キシ基、4-メトキシベンジルオキシ基、3-フェノキシベンジルオキシ基、2, 3 , 5 , 6-テトラフルオロベンジルオキシ基、2 , 3 , 5 , 6-テトラフルオロー4-メトキシベンジルオキシ基、2 , 3 , 5 , 6-テトラフルオロ-4-メトキシベンジルオキシ基、2 , 3 , 5 , 6-テトラフルオロ-4-メトキシメチルベンジルオキシ基、2 , 3 , 5 , 6-テトラフルオロ-4-メトキシメチルベンジルオキシ基等の炭素数 $7\sim 20$ の置換されていてもよいアラルキルオキシ基、

例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子、

例えば、アセチル基、エチルカルボニル基等の炭素数2~20の置換されていて もよいアシル基、

15 例えばフェニルカルボニル基、2-メチルフェニルカルボニル基、4-クロロフェニルカルボニル基、4-メチルフェニルカルボニル基、4-メトキシフェニルカルボニル基等の炭素数7~20の置換されていてもよいアリールカルボニル基、

例えばベンジルカルボニル基、4-クロロベンジルカルボニル基、4-メチルベンジルカルボニル基、4-メトキシベンジルカルボニル基等の炭素数8~20の置換されていてもよいアラルキルカルボニル基、

例えばメトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、tertーブトキシカルボニル基、トリフルオロメトキシカルボニル基等の炭素数2~20の置換されていてもよいアルコキシカルボニル基、

例えばフェノキシカルボニル基、2-メチルフェノキシカルボニル基、4-クロ 25 ロフェノキシカルボニル基、4-メチルフェノキシカルボニル基、4-メトキシフェ ノキシカルボニル基等の炭素数7~20の置換されていてもよいアリールオキシカル ボニル基、

例えばベンジルオキシカルボニル基、4-クロロベンジルオキシカルボニル基、 4-メチルベンジルオキシカルボニル基、4-メトキシベンジルオキシカルボニル基 WO 2005/044776

5

等の炭素数8~20の置換されていてもよいアラルキルオキシカルボニル基、例えば カルボキシ基等が例示される。

かかる置換基で置換されたアルキル基としては、例えば、クロロメチル基、フル オロメチル基、メトキシメチル基、エトキシメチル基、メトキシエチル基、メトキシ カルボニルメチル基等が挙げられる。

アリール基としては、例えばフェニル基、ナフチル基等の炭素数6~20のアリー ル基が挙げられる。かかるアリール基は、前記置換されていてもよいアルキル基、前 記アリール基、後述する置換されていてもよいアラルキル基、例えばメトキシ基、エ トキシ基、n-プロポキシ基、イソプロポキシ基、n-ブトキシ基、イソブトキシ基 、sec-ブトキシ基、tert-ブトキシ基、トリフルオロメトキシ基等の炭素数 10 1~20の置換されていてもよいアルコキシ基、例えばフェノキシ基、2-メチルフ ェノキシ基、4ークロロフェノキシ基、4ーメチルフェノキシ基、4ーメトキシフェ ノキシ基、3-フェノキシフェノキシ基等の炭素数6~20の置換されていてもよい アリールオキシ基、例えばベンジルオキシ基、4-クロロベンジルオキシ基、4-メ チルベンジルオキシ基、4-メトキシベンジルオキシ基、3-フェノキシベンジルオ 15 キシ基、2,3,5,6-テトラフルオロベンジルオキシ基、2,3,5,6-テト ラフルオロー4-メチルベンジルオキシ基、2,3,5,6-テトラフルオロー4-メトキシベンジルオキシ基、2, 3, 5, 6-テトラフルオロー4-メトキシメチル ベンジルオキシ基等の炭素数7~20の置換されていてもよいアラルキルオキシ基、 例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子等の置換基で 20 置換されていてもよい。

置換されていてもよいアリール基としては、例えばフェニル基、ナフチル基、2 ーメチルフェニル基、4-クロロフェニル基、4-メチルフェニル基、4-メトキシ フェニル基、3-フェノキシフェニル基等が挙げられる。

アラルキル基としては、例えばベンジル基、ナフチルメチル基等の炭素数 7~20 25 のアラルキル基が挙げられる。

かかるアラルキル基は、前記置換されていてもよいアルキル基、前記置換されて いてもよいアリール基、上記アラルキル基、例えばメトキシ基、エトキシ基、nープ ロポキシ基、イソプロポキシ基、n-ブトキシ基、イソブトキシ基、sec-ブトキ

10

15

20

シ基、 t e r t - ブトキシ基、トリフルオロメトキシ基等の炭素数 1 ~ 20の置換されていてもよいアルコキシ基、例えばフェノキシ基、2 - メチルフェノキシ基、4 - クロロフェノキシ基、4 - メチルフェノキシ基、4 - メトキシフェノキシ基、3 - フェノキシフェノキシ基等の炭素数 6 ~ 20の置換されていてもよいアリールオキシ基、例えばベンジルオキシ基、4 - クロロベンジルオキシ基、4 - メチルベンジルオキシ基、5,6 - テトラフルオロベンジルオキシ基、2,3,5,6 - テトラフルオロベンジルオキシ基、2,3,5,6 - テトラフルオロー4 - メチルベンジルオキシ基、2,3,5,6 - テトラフルオロー4 - メトキシベンジルオキシ基、5,6 - テトラフルオロー4 - メトキシベンジルオキシ基、5,6 - テトラフルオロー4 - メトキシベンジルオキシ基等の炭素数 7 ~ 20の置換されていてもよいアラルキルオキシ基、例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子等の置換基で置換されていてもよい。

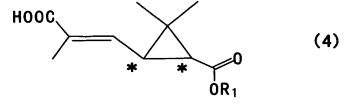
炭素数7~20の置換されていてもよいアラルキル基としては、好ましくは、ハロゲン原子、メチル基、メトキシ基、メトキシメチル基およびフェノキシ基からなる群より選ばれる置換基で置換されたベンジル基が例示され、具体的には、4-クロロベンジル基、4-メチルベンジル基、4-メトキシベンジル基、3-フェノキシベンジル基、2,3,5,6-テトラフルオロベンジル基、2,3,5,6-テトラフルオロー4-メトキシベンジル基、2,3,5,6-テトラフルオロー4-メトキシベンジル基、2,3,5,6-テトラフルオロー4-メトキシベンジル基、2,3,5,6-テトラフルオロー4-メトキシメチルベンジル基等が挙げられる。

 R_1 で表される基としては、好ましくは、直鎖状、分枝鎖状または環状の炭素数 1 ~ 20 のアルキル基、またはハロゲン原子、メチル基、メトキシ基、メトキシメチル基およびフェノキシ基からなる群より選ばれる置換基で置換されたベンジル基が挙げられる。

25 かかる第2菊酸エステル(1)としては、例えば3,3-ジメチル-2-(2-カルボキシ-1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸メチル、3,3-ジメチル-2-(2-カルボキシ-1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸エチル、3,3 -ジメチル-2-(2-カルボキシ-1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸イソプロピル、3,3-ジメチル-2-(2-カルボキシ-1-プロペニル)シクロプ

3、3-ジメチルー2-(2-カルボキシー1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸ベンジル、3、3-ジメチルー2-(2-カルボキシー1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸(4-クロロベンジル)、3、3-ジメチルー2-(2-カルボキシー1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸(2、3、5、6-テトラフルオロベンジル)、3、3-ジメチルー2-(2-カルボキシー1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸(2、3、5、6-テトラフルオロインジル)、3、3-ジメチルー2-(2-カルボキシー1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸(2、3、5、6-テトラフルオロー4-メトキシベンジル)、3、3-ジメチルー2-(2-カルボキシー1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸(2、3、5、6-テトラフルオロー4-メトキシメチルベンジル)、3、3-ジメチルー2-(2-カルボキシー1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸(3-フェノキシベンジル)等が挙げられる。

またかかる第2菊酸エステル(1)は、その分子内に不斉炭素原子を有しており、光学異性体が存在し、式(1)の化合物の光学異性体の単独またはそれらの混合物のいずれを用いてもよい。例えば、式(1)の化合物の光学異性体の単独またはそれらの混合物である式(4):



20

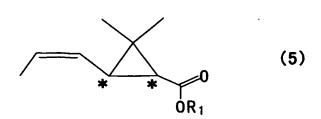
(式中、 R_1 は前記のとおりである、*は不斉炭素原子を表す。)で示される光学活性な3、3-ジメチル-2-(2-カルボキシ-1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸エステルを用いて反応を行い、3、<math>3-ジメチル-2-(1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸エステルが式(5):

10

15

20

25



(式中、 R_1 および*は前記のとおり。) で示される光学活性な3, 3-ジメチル -2-(1-プロペニル) シクロプロパンカルボン酸エステルを製造することもできる。

本発明で用いられる銅化合物としては、例えば酸化銅(I)、酢酸銅(I)、水酸化 銅(I)等の1価の銅化合物;例えば酸化銅(II)、酢酸銅(II)、水酸化銅(II)、 ナフテン酸銅(II)等の2価の銅化合物と例えば水素、ヒドラジン等の還元剤とを作 用せしめてなる銅化合物;銅金属と例えば酸素、過酸化水素等の酸化剤とを作用せし めてなる銅化合物等が挙げられ、これらは単独で用いても良いし、いくつかを混合し て用いても良い。

2価の銅化合物と還元剤とを作用させる場合または銅金属と酸化剤とを作用させる場合において、かかる操作は予め実施しておいてもよく、脱炭酸反応系中で同時並行的に行ってもよい。銅金属を用いる場合は、反応性向上のために、粒度ができるだけ細かい銅金属を用いることが好ましい。

かかる操作を予め実施しておく場合には、得られた銅化合物を取り出して脱炭酸反応に用いてもよいし、溶液もしくはスラリー状態のままで用いてもよい。また、上記の「脱炭酸反応系中で同時並行的に行う」とは、例えば第2菊酸エステル(1)、含窒素芳香族化合物、銅金属および酸化剤を同時に仕込んで加熱するような場合等をいう。

かかる銅化合物の使用量は、第2菊酸エステル(1)1モルに対して、後述する2配位性のない含窒素芳香族化合物を用いる場合は、好ましくは $0.1\sim2$ モル、より好ましくは $0.5\sim1.5$ モル程度であり、後述する2配位性がある含窒素芳香族化合物を用いる場合は、触媒量でよく、第2菊酸エステル(1)1モルに対して、好ましくは $0.01\sim0.5$ モル、より好ましくは $0.05\sim0.3$ モル程度である。

本発明で用いられる含窒素芳香族化合物としては、例えばピリジン環、キノリン環等の窒素原子を構成元素に含む含窒素芳香環を有する化合物、さらに詳しくは、2配

位性のない含窒素芳香族化合物 (例えば、キノリン、2-クロルキノリン、4-二トロキノリン、ピリジン、コリジン、ニコチン酸メチル、イソキノリン等から選ばれる含窒素芳香族化合物) および式 (3):

$$R_3 \xrightarrow{R_4} R_5 R_6 \xrightarrow{R_7} R_8$$
 (3)

5 (式中、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_5 、 R_5 、 R_7 、 R_8 および R_9 はそれぞれ同一または相異なって、水素原子、置換されていてもよいアルキル基、置換されていてもよいアルコキシ基、置換されていてもよいアリール基、置換されていてもよいアリールオキシ基、置換されていてもよいアラルキル基、置換されていてもよいアラルキルオキシ基、置換されていてもよいアルケニル基、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、置換されていてもよいアルカニル基、スルホ基または置換されていてもよいアルコキシカルボニル基を表わす。ここで、 R_2 と R_3 、 R_3 と R_4 、 R_4 と R_5 、 R_5 と R_6 、 R_5 と R_7 、 R_7 と R_8 または R_8 と R_9 が結合して、芳香環を含む環構造の一部を形成してもよい。)で表される2配位性の含窒素化合物とが挙げられる。

2配位性のない含窒素芳香族化合物の含窒素芳香環は、置換基を有していてもよ く、該置換基としては、前記置換されていてもよいアルキル基、前記置換されていて 15 もよいアリール基、前記置換されていてもよいアラルキル基、例えばメトキシ基、エ トキシ基、n-プロポキシ基、イソプロポキシ基、n-ブトキシ基、イソブトキシ基 、sec-ブトキシ基、tert-ブトキシ基、トリフルオロメトキシ基等の置換さ れていてもよいアルコキシ基、例えばフェノキシ基、2-メチルフェノキシ基、4-クロロフェノキシ基、4ーメチルフェノキシ基、4ーメトキシフェノキシ基、3ーフ 20 ェノキシフェノキシ基等の置換されていてもよいアリールオキシ基、例えばベンジル オキシ基、4-クロロベンジルオキシ基、4-メチルベンジルオキシ基、4-メトキ シベンジルオキシ基、3-フェノキシベンジルオキシ基等の置換されていてもよいア ラルキルオキシ基、例えばアセチル基、エチルカルボニル基等の置換されていてもよ いアシル基、例えばメトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、tert-ブト 25 キシカルボニル基、トリフルオロメトキシカルボニル基等の置換されていてもよいア ルコキシカルボニル基、例えばフェノキシカルポニル基、2-メチルフェノキシカル ボニル基、4-クロロフェノキシカルボニル基、4-メチルフェノキシカルボニル基、4-メトキシフェノキシカルボニル基等の置換されていてもよいアリールオキシカルボニル基、例えばベンジルオキシカルボニル基、4-クロロベンジルオキシカルボニル基、4-メトキシベンジルオキシカルボニル基等の置換されていてもよいカルボアラルキルオキシ基、例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子、スルホ基、シアノ基、水酸基、ニトロ基、アミノ基等が挙げられる。また、これら置換基のうち、隣接する置換基が結合して、その結合炭素原子を含む環を形成してもよい。

かかる2配位性のない含窒素芳香族化合物としては、例えば、前記のようなキノリ 10 ン、2-クロルキノリン、4-ニトロキノリン、ピリジン、コリジン、ニコチン酸メ チル、イソキノリン等が挙げられ、キノリンが好ましく用いられる。

2配位性のない含窒素芳香族化合物の使用量は、第2菊酸エステル(1)1モルに対して、通常0.5モル以上である。その上限は特になく、溶媒を兼ねて、大過剰量用いてもよい。

15 本発明に用いられる式 (3) で示される 2 配位性の含窒素化合物の置換基 R₂~R gとしては、例えば水素原子、ならびに R₁で表される基として前記した置換されていてもよいアルキル基、後述する置換されていてもよいアルケニル基、前記した置換されていてもよいアリール基、前記した置換されていてもよいアラルキル基、前記した置換されていてもよいアリールオキシ 基、前記した置換されていてもよいアリールオキシ 基、前記した置換されていてもよいアラルキルオキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、前記した置換されていてもよいアシル基または前記した置換されていてもよいアルコキシカルボニル基などが挙げられる。

・置換されていてもよいアルケニル基としては、例えばエテニル基、1ープロペニル基、2ープロペニル基、1ーメチルエテニル基、1ーブテニル基、2ープテニル基
 25 、3ープテニル基、1ーメチルー1ープロペニル基、2ーメチルー1ープロペニル基、1ーメチルー2ープロペニル基、1ーペンテニル基、2ーペンテニル基、3ーペンテニル基、1ーへキセニル基、1ーデセニル基、2ーシクロペンテニル基、2ーシクロペナテニル基、2ーシクロペンテニル基、2ーシクロペキセニル基等の炭素数2~12のアルケニル基およびこれらアルケニル基の一つまたは二つ以上の水素原子が、例えば後述するアルコキシ基、アリールオキシ基、ア

かかる2配位性の含窒素化合物としては、メチル基、メトキシ基、ベンジル基、ベンジルオキシ基、フェニル基、フェノキシ基、シアノ基、メトキシカルボニル基、アセチル基、スルホ基、ハロゲン原子もしくはニトロ基で置換されていてもよい、2,

10 2 '-ビピリジルあるいは1,10-フェナンスロリンが好ましい。

かかる2配位性の含窒素化合物の具体例としては、例えば2,2'ービピリジル、5,5'ージシアノー2,2'ービピリジル、4,4'ージベンジルー2,2'ービピリジル等のビピリジル化合物、さらに1,10ーフェナンスロリン、4,7ージフェニルー1,10ーフェナンスロリン、3,4,7,8ーテトラメチルー1,10ーフェナンスロリン、4,7ージフェナンスロリン、4,7ージメトキシー1,10ーフェナンスロリン、4,7ージフェノキシー1,10ーフェナンスロリン、4,7ージベンジロキシー1,10ーフェナンスロリン、3,8ージプロモー1,10ーフェナンスロリン、3,8ージクロロー1,10ーフェナンスロリン、4,7ージニトロー1,10ーフェナンスロリン、2,9ージカルボメトキシー1,10ーフェナンスロリン、2ーアセチルー1,10ーフェナンスロリン、1,10ーフェナンスロリン、4,7ージスルホン酸、ベンソ[f][1,10]ーフェナンスロリン等の1,10ーフェナンスロリン化合物が

2配位性の含窒素化合物の使用量は、触媒量でよく、第2菊酸エステル(1)1モルに対して、好ましくは、0.01~0.5モル、より好ましくは0.05~0.3 モル程度である。このように含窒素芳香族化合物として2配位性の含窒素化合物を用いれば、銅化合物量と含窒素化合物量を触媒量まで削減することができる。

上記反応は、有機溶媒の存在下に実施しても良いが、2配位性の含窒素化合物を用いる場合は、有機溶媒の存在下に実施することが望ましい。 有機溶媒を使用する場合、かかる有機溶媒としては、反応を阻害しないものであれば、特に限定されずに用

~100重量部程度である。

5

10

15

25

いられる。例えばクロロベンゼン、 o ージクロロベンゼン、 m ージクロロベンゼンなどのハロゲン化炭化水素、例えばベンゼン、トルエン、ニトロベンゼン等の芳香族炭化水素、例えば n ーデカン、ドデカン、テトラデカンなどの脂肪族炭化水素等が挙げられる。好ましくは、例えばキノリン、2 ークロルキノリン、4 ーニトロキノリン、ピリジン、コリジン、ニコチン酸メチル、イソキノリン等の含窒素芳香族化合物が挙げられる。その使用量は、第2 菊酸エステル(1)1 重量部に対して、通常、0.5

本発明は、さらに酸化アルミニウムを添加してその存在下に実施することでより効率良く反応を進行させることができる。酸化アルミニウムは、γ型、α型いずれでも用いることができる。また、酸性、中性、塩基性いずれのものも用いることができるが、塩基性から中性アルミナが好ましい。その使用量は、特には限定されないが、第2菊酸エステル(1)1重量部に対して、通常、0.1~2重量部程度である。本反応は、第2菊酸エステル(1)、銅化合物、含窒素化合物、溶媒および必要に応じて酸化アルミニウムを混合すればよく、その混合順序は特に制限されない。例えば一括で、これらを混合した後に、反応温度まで昇温しても良いし、銅化合物、含窒素化合物、溶媒および必要に応じて酸化アルミニウムを混合し、反応温度に設定した混合物中に、第2菊酸エステル(1)を加えても良い。

反応温度は、通常、150℃~230℃程度の範囲である。

反応は通常、常圧で行われるが、加圧下あるいは減圧下で行っても良い。

20 反応の進行は、ガスクロマトグラフィー、高速液体クロマトグラフィー、薄層クロマトグラフィー、NMR、IR等の通常の分析手段により確認することができ、第2 菊酸エステル(1)の消失が確認できた時点で反応を終了させることができる。

反応終了後、目的物は、例えば、反応マスから銅化合物や酸化アルミニウムを、必要に応じてろ過した後に、溶媒等を留去するか、あるいは含窒素芳香族化合物を、酸性水溶液と必要に応じて水と分液可能な溶媒を加えて分液処理することで、目的の3,3-ジメチル-2-(1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸エステルと含窒素芳香族化合物を分離した後、濃縮することで目的の3,3-ジメチル-2-(1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸エステルを得ることができる。

得られた3、3-ジメチル-2-(1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸

エステルはさらに、蒸留、カラムクロマトグラフィー等の通常の分離手段を用いることで単離することもできる。水に不溶の有機溶媒としては、例えばジクロロメタン、クロロホルム、クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素溶媒;例えばジエチルエーテル、メチル t e r t ープチルエーテル等のエーテル溶媒;例えば酢酸エチル等のエステル溶媒;などが挙げられ、その使用量は特に制限されない。

かくして得られる式 (2) で示される 3, 3 - ジメチル-2 - (1 - プロペニル) シクロプロパンカルボン酸エステルとしては、例えば 3, 3 - ジメチル-2 - (1 - プロペニル) シクロプロパンカルボン酸メチル、 3, 3 - ジメチル-2 - (1 - プロペニル) シクロプロパンカルボン酸エチル、 3, 3 - ジメチル-2 - (1 - プロペニル) シクロプロパンカルボン酸イソプロピル、 3, 3 - ジメチル-2 - (1 - プロペニル) シクロプロパンカルボン酸 t e r t - ブチル、 3, 3 - ジメチル-2 - (1 - プロペニル) シクロプロパンカルボン酸シクロヘキシル、 3, 3 - ジメチル-2 - (1 - プロペニル) シクロプロパンカルボン酸シクロヘキシル、 3, 3 - ジメチル-2 - (1 - プロペニル) シクロプロパンカルボン酸メンチル、

3、3-iジメチルー2ー($1-\mathcal{P}$ ロペニル)シクロプロパンカルボン酸ベンジル、 15 3、3-iジメチルー2ー($1-\mathcal{P}$ ロペニル)シクロプロパンカルボン酸(4-クロロベンジル)、3、3-iジメチルー2ー($1-\mathcal{P}$ ロペニル)シクロプロパンカルボン酸(2、3、5、6-テトラフルオロベンジル)、3、3-iジメチルー2ー($1-\mathcal{P}$ ロペニル)シクロプロパンカルボン酸(2, 3, 5, 6-テトラフルオロー4-メチルベンジル)、3、3-iジメチルー2ー($1-\mathcal{P}$ ロペニル)シクロプロパンカルボン酸(2, 3, 5, 6-テトラフルオロー4-メトキシベンジル)、3, 3-iジメチルー2-($1-\mathcal{P}$ ロペニル)シクロプロパンカルボン酸(2, 3, 5, 6-テトラフルオロー4-メトキシベンジル)、3, 3-iジメチルー2-($1-\mathcal{P}$ ロペニル)シクロプロパンカルボン酸(2, 3, 5, 6-テトラフルオロー4-メトキシメチルベンジル)、3, 3-iジメチルー2-($1-\mathcal{P}$ ロペニル)シクロプロパンカルボン酸(3-フェノキシベンジル)等が挙げられる。

なお、第2菊酸エステル(1)として、光学活性体を用いた場合には、通常、ほ 25 ぼ光学純度を保持して3,3-ジメチル-2-(1-プロペニル)シクロプロパンカ ルボン酸エステル化合物が得られる。

実施例

以下、実施例によって本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれら実施例によ

り限定されるものではない。なお、収率およびE/Z比はガスクロマトグラフィー分析法 (内部標準法) の結果に基づき算出した。ここで、E/Z比とは二重結合部分のメチル基とシクロプロパン環との立体配置の比を表わす。また、光学純度は、高速液体クロマトグラフィ (以下、LCと略記する。) 分析法 (面積比較法) により実施し

5 た。

<GC分析条件>

カラム: DB-1 (φ0. 25 μm×30m、膜厚1. 0 μm)

キャリアガス: ヘリウム (流速: 1 m/分)

スプリット比: 1/10、試料注入量: 1 µ L

10 カラム温度:100℃(0分)→180℃(昇温速度:2℃/分、180℃での保持時間:0分)→300℃(昇温速度:10℃/分、300℃での保持時間:15分)

注入口温度:200℃、検出器温度:250℃

< L C分析条件>

15 カラム: SUMICHIRAL OA-2500 (5 μ m, ϕ 4.6 mm×25 cm×2本)

移動相: n-ヘキサン

流量: 0. 7 m L / 分、試料注入量: 1 μ L、検出波長: 2 2 0 n m

20 実施例1

25

窒素置換した100m1m0フラスコに酸化銅(I)70mg、キノリン2g及び3,3-ジメチル-2-(2-カルボキシ-1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸メチル<math>212mgを仕込み、窒素雰囲気下で180Cまで昇温し、同温度で3時間攪拌後、冷却し、反応液に10%硫酸水10gとトルエン5gを加え、分液して3,3-ジメチル-2-(1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸メチルを含む有機

層を得た。3, 3-ジメチル-2-(1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸メチルの収率は<math>6.9%、E/Z比=5:95であった。

実施例2

30 空気雰囲気で100mlのフラスコに銅粉65mg、キノリン2g及び3,3-ジ

メチルー2ー(2-カルボキシー1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸メチル $212 \,\mathrm{mg}\, s$ 仕込み、空気雰囲気下で $180\,\mathrm{C}$ まで昇温し、同温度で3 時間攪拌後、 冷却し、反応液に $10\,\mathrm{%}$ 硫酸水 $10\,\mathrm{g}\, c$ トルエン $5\,\mathrm{g}\, s$ 加え、分液して3, 3-ジメチルー2-(1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸メチルを含む有機層を得た。 3, 3-ジメチルー2-(1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸メチルの収率は $52\,\mathrm{W}$ 、E/2比= $11:89\,\mathrm{C}$ であった。

実施例3

5

窒素置換した100mlのフラスコに酸化銅(I) 5mg、銅粉30mg、キノリ
10 ン1g及び(+)トランスー3,3ージメチルー2ー(2ーカルボキシー1ープロペ
ニル)シクロプロパンカルボン酸メチル(d体比:95.5%)106mgを仕込み
、窒素雰囲気下で180℃まで昇温し、同温度で3時間攪拌後、冷却し、反応液に1
0%硫酸水10gとトルエン5gを加え、分液して(+)トランスー3,3ージメチ
ルー2ー(1ープロペニル)シクロプロパンカルボン酸メチルを含む有機層を得た。
15 3,3ージメチルー2ー(1ープロペニル)シクロプロパンカルボン酸メチルの収率
は65%、E/Z比=5:95であった。また、E体のd体とZ体のd体を合わせた
d体比は95.5%であった。

比較例1

20 窒素置換したフラスコ中で、窒素雰囲気下で行うこと以外は実施例2と同様に実施 したところ、3,3-ジメチル-2-(1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸 メチルの収率は0.8%であり、原料の3,3-ジメチル-2-(2-カルボキシー 1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸メチルが98%回収された。

25 実施例 4

窒素置換した100mlのフラスコに酸化銅(I) 35mg、1, 10-フェナンスロリン1水和物99mg、テトラデカン2g及び3, 3-ジメチルー2-(2-カルボキシ-1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸メチル212mgを仕込み、窒素雰囲気下で180℃まで昇温し、同温度で2時間攪拌後、冷却し、反応液に10

PCT/JP2004/016703

%硫酸水10gとトルエン5gを加え、分液して3,3-ジメチルー2ー(1ープロペニル)シクロプロパンカルボン酸メチルを含む有機層を得た。3,3-ジメチルー2ー(1ープロペニル)シクロプロパンカルボン酸メチルの収率は59%、E/Z比=4:96であった。

5

実施例5

窒素置換した100mlのフラスコに酸化銅(I) 70mg、2, 2 'ービピリジル156mg、テトラデカン2g及び3, 3ージメチルー2ー(2ーカルボキシー1ープロペニル)シクロプロパンカルボン酸メチル212mgを仕込み、窒素雰囲気下で180℃まで昇温し、同温度で2時間攪拌後、冷却し、反応液に10%硫酸水10gとトルエン5gを加え、分液して3, 3ージメチルー2ー(1ープロペニル)シクロプロパンカルボン酸メチルを含む有機層を得た。3, 3ージメチルー2ー(1ープロペニル)シクロペニル)シクロプロパンカルボン酸メチルを含む有機層を得た。3, 3ージメチルー2ー(1ープロペニル)シクロプロパンカルボン酸メチルの収率は61%、E/Z比=7:93であった。

15

10

実施例6

窒素置換した100m1のフラスコに酸化銅(I)5mg、1, 10-フェナンス ny 1 ny 1

25

20

実施例7

窒素置換した300m1のフラスコに酸化銅(I)200mg、4, 7-ジフェニル-1, 10-フェナンスロリン<math>1000mg、中性アルミナ2g、キノリン5gを仕込み、窒素雰囲気下で180℃まで昇温した。この混合液に3, 3-ジメチル-2

- (2-カルボキシー1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸メチル2.12gをキノリン5gに溶解して、4時間で滴下した。滴下後、さらに、同温度で2時間攪拌後、冷却し、反応液に10%硫酸水50gとトルエン50gを加え、分液して3、3-ジメチル-2-(1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸メチルを含む有機5 層を得た。3、3-ジメチル-2-(1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸メチルの収率は91%、E/2比=1:99であった。

実施例8

実施例7において、4,7-ジフェニル-1,10-フェナンスロリンの仕込み量 10 を100mgに代える以外は、実施例7と同様に実施して、3,3-ジメチル-2- (1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸メチルを含む有機層を得た。3,3-ジメチル-2- (1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸メチルの収率は73%、E/2比=3:97であった。

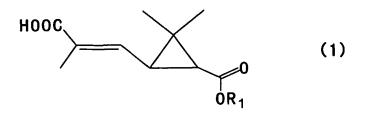
15 産業上の利用可能性

本発明の方法によれば、工業的に取り扱いが困難な試剤または高価な試剤あるいは特殊な反応装置等を用いることなく、また大量の廃棄物を副生することもなく、家庭用防疫薬の酸部分として重要な化合物である3,3-ジメチルー2-(1-プロペニル)-シクロプロパンカルボン酸エステルを効率的に製造することができる。

請求の範囲

1. 式(1)

5



(式中、R」は置換されていてもよいアルキル基、置換されていてもよいアリール基 または置換されていてもよいアラルキル基を表わす。)

で示される3,3-ジメチル-2-(2-カルボキシ-1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸エステルを銅化合物および含窒素芳香族化合物と接触させることを特徴とする式(2)

10 (式中、R1、は上記と同じ意味を表わす。)

で表される3, 3-ジメチル-2- (1-プロペニル)シクロプロパンカルボン酸エステルの製造方法。

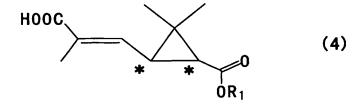
- 2. 銅化合物が、1価の銅化合物である請求項1に記載の製造方法。
- 3. 銅化合物が、2価の銅化合物と還元剤とを作用せしめて得られる銅化合物である 15 請求項1に記載の製造方法。
 - 4. 銅化合物が、銅金属と酸化剤とを作用せしめて得られる銅化合物である請求項1に記載の製造方法。
 - 5. 含窒素芳香族化合物がキノリンである請求項1~4のいずれかに記載の製造方法

20 6. 含窒素芳香族化合物が式(3):

(式中、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_5 、 R_5 、 R_7 、 R_8 および R_9 はそれぞれ同一または相異なって、水素原子、置換されていてもよいアルキル基、

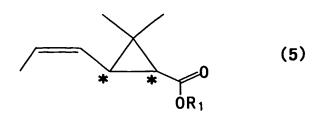
置換されていてもよいアルコキシ基、置換されていてもよいアリール基、

- 7. 2配位性の含窒素化合物が1, 10-フェナンスロリン化合物である請求項6に記載の製造方法。
- 8. 溶媒が含窒素芳香族化合物である請求項6に記載の製造方法。
- 9. 溶媒がキノリンである請求項8に記載の製造方法。
- 15 10.酸化アルミニウムの存在下に実施する請求項1に記載の製造方法。
 - 11. 反応温度が150℃~230℃である請求項1に記載の製造方法。
 - 12. 式(1)の3,3-ジメチル-2-(2-カルボキシ-1-プロペニル)シ クロプロパンカルボン酸エステルの光学異性体の単独またはそれらの混合物である式 (4):



20

(式中、 R_1 は前記のとおりである、*は不斉炭素原子を表す。) で示される光学活性な 3、3-ジメチル-2-(2-カルボキシ-1-プロペニル) シクロプロパンカルボン酸エステルを反応させて、式 (5):



(式中、 R_1 および*は前記のとおり。)で示される光学活性な3, $3-ジメチルー <math>2-(1-\mathcal{L}^2$ ロペニル)シクロプロパンカルボン酸エステルを製造する請求項1に記載の製造方法。

5 13. R₁が、直鎖状、分枝鎖状または環状の炭素数 1~20のアルキル基、またはハロゲン原子、メチル基、メトキシ基、メトキシメチル基およびフェノキシ基からなる群より選ばれる置換基で置換されたベンジル基である請求項 1 から12のいずれかーに記載の製造方法。

14. 2配位性の含窒素化合物が、メチル基、メトキシ基、ベンジル基、ベンジル 10 オキシ基、フェニル基、フェノキシ基、シアノ基、メトキシカルボニル基、アセチル 基、スルホ基、ハロゲン原子もしくはニトロ基で置換されていてもよい、2,2 '-ビピリジルあるいは1,10-フェナンスロリンである請求項6に記載の製造方法。 15. 光学活性な3,3-ジメチル-2-(2-カルボキシ-1-プロペニル)シ クロプロパンカルボン酸エステルおよび光学活性な3,3-ジメチル-2-(1-プ 15 ロペニル)シクロプロパンカルボン酸エステルが、(+)-トランス体である請求項 12に記載に製造方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/016703

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl⁷ C07C67/32, 69/747//B01J23/72, 31/22, 31/28, C07M7:00, 9:00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ C07C67/32, 69/743-69/747, C07B37/06, 53/00, C07M7:00-9:00,

B01J23/72, 31/22, 31/28-31/30

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1922–1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994–2005

Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971–2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996–2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
CA (STN), REGISTRY (STN)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2001-261618 A (Sumitomo Chemical Co., Ltd.), 26 September, 2001 (26.09.01)	1-15
Y	PATTENDEN, Gerald et al., Acid thermal decomposition products of natural chrysanthemumcarboxylic acid, J.Chem.Soc.C., 1971, (16), 2739-2743: Chemical abstrscts, Vol.75, No.15, 11 October, 1971 (11.10.71), page 286, the abstract No.98205s	1-15
Y	JP 49-66660 A (Sumitomo Chemical Co., Ltd.), 27 June, 1974 (27.06.74)	1-15
Y	JP 52-100451 A (Bayer AG.), 23 August, 1977 (23.08.77)	1-15

×	Further documents are listed in the continuation of Box C.	×	See patent family annex.
* "A"	Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T"	later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"E"	earlier application or patent but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is	"X"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination		
	"&"	being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family	
Date	of the actual completion of the international search 02 February, 2005 (02.02.05)	Date	of mailing of the international search report 22 February, 2005 (22.02.05)
	e and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Aut	horized officer
Facs	imile No.	Tele	phone No.

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/016703

). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 56-40616 A (San'abotto Kabushiki Kaisha), 16 April, 1981 (16.04.81)	1-15
Y	JP 4-279540 A (Union Carbide Chemicals and Plastics Co., Inc.), 05 October, 1992 (05.10.92)	10,13
•		
·		
		·

INTERNATIONAL SEARCE		International application No. PCT/JP2004/016703		
JP 2001-261618 A	2001.09.26	CN 1303845 A US 2001/0014755 A1		
JP 49-66660 A	1974.06.27	(Family: none)		
JP 52-100451 A	1977.08.23	AT 7701070 A BE 851524 A BR 7700999 A DE 2606635 A1 DK 7700710 A FR 2341553 A1 GB 1571432 A GB 1571433 A GB 1571434 A NL 7701695 A		
JP 56-40616 A	1981.04.16	(Family: none)		
JP 4-279540 A	1992.10.05	AU 9184643 A CA 2051484 A1 DE 69130474 T2 EP 478075 A2 ES 2123504 T3 KR 180242 B1 US 5164497 A		

国際調査報告

A. 発明の風する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl. 7

C07C 67/32, 69/747

//B01J 23/72, 31/22, 31/28,

C07M 7:00, 9:00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

· Int. Cl. 7

CO7C 67/32, 69/743-69/747,

C07B 37/06, 53/00, C07M 7:00-9:00,

B01J 23/72, 31/22, 31/28-31/30

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2004年

日本国登録実用新案公報

1994-2005年

日本国実用新案登録公報

1.996-2004年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

CA (STN)

REGISTRY (STN)

C. 関連する	らと認められる文献	
引用文献の		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
Y	JP 2001-261618 A (住友化学工業株式会社), 2001.09.26	1-15
Y	PATTENDEN, Gerald et al., Acid thermal decomposition products of natural chrysanthemumcarboxylic acid, J. Chem. Soc. C, 1971, (16), 2739-2743: Chemical abstracts, Vol. 75, No. 15, 1971. 10. 11, p. 286, the abstract No. 98205s	1-15

✓ C欄の続きにも文献が列挙されている。

√ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

TI I I I I I I I I I I I I I I I I I I	- 00,212		
国際調査を完了した日	02.02.2005	国際調査報告の発送日 22.2.	2005
国際調査機関の名称及びあ 日本国特許庁(I	SA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 山 本 昌 広	4 V 9 2 8 0
	の-8915 が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 P	内線 3483

国際調査報告

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する
Y	JP 49-66660 A (住友化学工業株式会社), 1974.06.27	1-15
Y	JP 52-100451 A (バイエル・アクチェンゲゼルシャフト), 1977.08.23	1-15
Y	JP 56-40616 A (サンアボット株式会社), 1981.04.16	1-15
Y	JP 4-279540 A (ユニオン・カーバイド・ケミカルズ・アンド・ プラスティックス・カンパニー・インコーポレイテッド), 1992.10.05	10, 13

国院調金報告 パテントファミリーに関する情報

国際出願番号 PCT/JP2004/016703

JP 2001-261618 A	2001. 09. 26	CN 1303845 A US 2001/0014755 A1
JP 49-66660 A	1974. 06. 27	ファミリーなし
JP 52-100451 A	1977. 08. 23	AT 7701070 A BE 851524 A BR 7700999 A DE 2606635 A1 DK 7700710 A FR 2341553 A1 GB 1571432 A GB 1571434 A NL 7701695 A
JP 56-40616 A	1981. 04. 16	ファミリーなし
JP 4-279540 A	1992. 10. 05	AU 9184643 A CA 2051484 A1 DE 69130474 T2 EP 478075 A2 ES 2123504 T3 KR 180242 B1 US 5164497 A